NEWS RELEASE

広島大学 TEL: 082-424-4518 FAX: 082-424-6040 E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp

令和2年2月25日

「国際ナノデバイステクノロジーワークショップ2020」 を中止します

なお、時期を改めて同趣旨で開催する予定です。

コロナウイルスの国内感染の拡大による影響を考え、開催を予定しておりました 「国際ナノデバイステクノロジーワークショップ2020」を中止とさせていただき ます。なお、改めて同趣旨で開催する予定です。

― 以下、令和2年2月17日付け案内文 ―

令和2年2月17日

広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 「国際ナノデバイステクノロジーワークショップ2020」を開催

広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所では、「国際ナノデバイステクノロ ジーワークショップ2020」(IWNT2020)を、下記のとおり開催いたします。

国内外の研究機関および民間企業より著名な研究者をお招きし、半導体デバイスに 関する先端研究についてご講演いただきます。参加費は無料でどなたでもお聞きいた だけますので、下記の申込Webページよりご登録をお願いします。なお、使用言語は 英語です。

記

■開催日時: 2020年3月6日(金) 9:20~17:40 ■場 所: 広島大学サタケメモリアルホール(東広島キャンパス) https://www.hiroshima-u.ac.jp/memorialhall

■参加費: 無料(懇親会参加費は有料)

■参加申込受付:http://www.rnbs.hiroshima-u.ac.jp/iwnt2020.html

■プログラム ※講演は英語で行われます。

9:00 受付開始

9:20-09:30 オープニング 河原 能久(広島大学 理事・副学長)

9:30-10:10 【基調講演】 松波 弘之 (京都大学 名誉教授)

「シリコンカーバイド・パワー半導体デバイスの研究開発」

10:10-10:50 【基調講演】 谷口 研二 (大阪大学 名誉教授)

「振動発電デバイス向け微小電力抽出回路」

10:50-11:00 休憩

11:00-11:30 【招待講演】 Carl-Mikael Zetterling (KTH スウェーデン王立工科大学 教授)

「高温環境用シリコンカーバイド集積回路の研究開発」

11:30-12:00 【招待講演】James Im (コロンビア大学 教授) 「薄膜トランジスタおよび将来デバイスに向けた シリコン薄膜のファイバーレーザーアニール技術」

12:00-13:00 昼食

13:00-13:50 ポスター発表

14:OO-14:40 【基調講演】 金山敏彦 (産業技術総合研究所 特別顧問) 「ナノスケールトランジスタのための金属コンタクト形成技術」

14:40-15:10 【招待講演】 高木信一(東京大学 教授) 「先端ロジック LSI のための MOS デバイス技術」

15:10-15:40 【招待講演】 青砥なほみ (マイクロンメモリ ジャパン合同会社) 「半導体メモリの未来、ともにある未来を語る」

15:40-16:00 休憩

16:00-16:30 【招待講演】 田中徹 (東北大学 教授) 「三次元集積回路技術を用いたバイオメディカル集積化デバイスの 開発」

16:30-17:00 【招待講演】 宮原裕二 (東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 所長) 「バイオトランジスタを用いた生体分子認識および細胞機能の検出」

17:00-17:30 【招待講演】 Yanli Pei (中山大学 教授) 「チップゲート電極集積化 In₂O₃ 薄膜トランジスタによる バイオセンサ」

17:30-17:40 クロージング

18:00-19:30 懇親会(有料)(学士会館 1F レストラン)

- ■主催 広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
- ■共催 応用物理学会中国四国支部
- ■協力 文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム 文部科学省 生体医歯工学共同研究拠点: 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 東京工業大学 未来産業技術研究所 広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 静岡大学 電子工学研究所

■後援 東広島市

【お問い合わせ先】

広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所

国際ナノデバイステクノロジーワークショップ 事務局

メール:IWNT2020-Sec@ml.hiroshima-u.ac.ip

電 話:082-424-6265

Web: http://www.rnbs.hiroshima-u.ac.jp/

発信枚数: A 4版 4枚(本票含む)